L10 ANSWER 1 OF 4 WPIDS COPYRIGHT 2001 DERWENT INFORMATION LTD PI JP 11333282 A 19991207 (200008)\* 8p B01J008-02 <--AN 2000-091724 [08] WPIDS

JP 11333282 A UPAB: 20000215

AB

NOVELTY - Particulate catalyst fed into a hopper (1) is guided along a floating passage (9) by an inclined wall (12). Catalyst layer thickness (T) at an outlet (10) is adjusted by a number of setters (7). The catalyst moves on a conveyor (3) divided into a number of passages by partition walls (6). Width of each passage is set according to the number of reaction tube (2) lined up across the conveying direction.

USE - For stuffing reaction tube with particulate catalyst.

ADVANTAGE - Shortens supply time of catalyst to each reaction tube, decreases manual labor of the operation. Enables temperature control near reaction tube easily. Enhances yield selectivity. Reduces cost due to increased life span of catalyst. DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows a schematic side view of feed zone. (1) Hopper; (2) Reaction tube; (3) Conveyor; (6) Partition wall; (7) Setters; (9) Floating passage; (10) Outlet.

Dwg.1/6

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  | • |  |  |
|  |   |  |  |

(19)日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平11-333282

(43)公開日 平成11年(1999)12月7日

(51)Int.Cl. 6

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

B01J 8/02 B65G 65/42 B01J 8/02

A

B65G 65/42

В

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全8頁)

(21)出願番号

特願平10-149281

(22)出願日

平成10年(1998) 5月29日

(71)出願人 000002093

住友化学工業株式会社

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

(72)発明者 馬場 勝男

愛媛県新居浜市惣間町5番1号 住友化学

工業株式会社内

(72)発明者 西 朗

愛媛県新居浜市惣間町5番1号 住友化学

工業株式会社内

(72)発明者 上田 浩彦

千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目7番1号

住友ケミカルエンジニアリング株式会社内

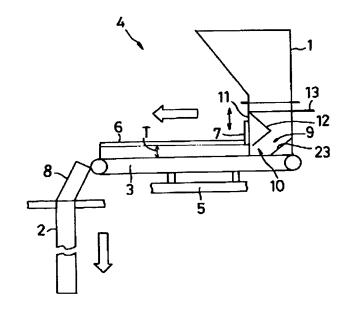
(74)代理人 弁理士 鈴木 崇生 (外4名)

#### (54) 【発明の名称】触媒充填機

# (57)【要約】

【課題】 反応管への触媒の供給作業時間の短縮化と作業者の労力の軽減化とを図るとともに、収率・選択率を向上させ、反応管に対する温度調整の容易化を図り、触媒を寿命に達するまで使い切れるようにして触媒に要するコストを低廉化する。

【解決手段】 反応管2にその上方側から粒子状の触媒を供給する触媒供給部4を、多数の反応管2に各別に対応可能に、反応管2が並ぶ方向に位置変更自在に支持フレーム5に支持させ、触媒供給部4を構成するに、ホッパー1から流下する触媒を載せて反応管2に搬送供給するコンベア3を設け、コンベア3の送り幅を、搬送幅方向に並ぶ所定数の反応管2に対応した幅に設定するともに、搬送空間を各反応管2ごとに対応させて仕切る仕切り壁6と、搬送触媒の層厚さを設定する層厚さ設定部7とを設け、コンベア3が設定搬送速度で触媒を搬送するよう構成してある。



1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 反応管にその上方側から粒子状の触媒を 供給する触媒供給部を、多数の反応管に各別に対応可能 に、前記反応管が並ぶ方向に位置変更自在に支持フレー ムに支持させ、前記触媒供給部を構成するに、ホッパー から流下する触媒を載せて前記反応管に搬送供給するコ ンベアを設け、前記コンベアの送り幅を、搬送幅方向に 並ぶ所定数の反応管に対応した幅に設定するとともに、 コンベア搬送面の上方の搬送空間を各反応管ごとに対応 させて前記搬送幅方向で仕切る仕切り壁と、搬送触媒の 10 層厚さを設定する層厚さ設定部とを設け、前記コンベア が設定搬送速度で触媒を搬送するよう構成してある触媒 充填機。

【請求項2】 前記ホッパーの下端側の触媒流下通路 を、下端部側ほど前記コンベアの搬送方向下手側に位置 する傾斜通路に形成してある請求項1記載の触媒充填 機。

【請求項3】 前記ホッパーの触媒吐出口の垂直方向上 方側に触媒の傾斜案内壁を設けて、触媒を前記傾斜案内 壁で案内して前記触媒吐出口側に流下させるよう構成し 20 てある請求項1又は2記載の触媒充填機。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は触媒充填機に関す る。

#### [0002]

【従来の技術】粒子状の触媒が充填される縦姿勢の多数 の反応管は、収率の向上・反応温度の調節等のためにそ れぞれ管径を小さく管長を長く設定してある。

【0003】そのために、反応管に多数の触媒を一挙に 投入した場合、触媒が落下中にせり合って反応管内にブ リッジと呼ばれる架橋が生じやすい。

【0004】ブリッジが生じると、各反応管内での触媒 の分布が不均一になり、反応管ごとに反応流体の流通抵 抗が異なって次のような問題が生じる。つまり、

1) ある反応管では反応流体と触媒との接触が過大で副 反応が多くなり、他の反応管では前記接触が過少で未反 応成分が多くなるというように、反応管ごとに反応状態 が異なって収率・選択率が低下する。

【0005】2) 各反応管を通過する反応流体の圧力損 40 失が不均一になり、各反応管の反応温度が不均一になっ て、反応管に対する温度調整が困難になる。

【0006】3) 反応流体が最も多く流れる反応管内の 触媒が、他の反応管内の触媒よりも早く寿命に達して収 率を低下させることから、前者の反応管内の触媒が寿命 に達すると、まだ寿命に達していない後者の反応管内の 触媒も、前者の反応管内の触媒とともに新しい触媒と交 換しなければならず、触媒に要するコストが高くなる。

【0007】そこで従来ではブリッジが生じないよう

いた。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従 来の技術のように作業者が触媒を反応管に少しづつ慎重 に投入するという手段では、反応管が多数あるために多 大の労力と時間を必要としていた。

【0009】この問題を解消するために、例えば特公昭 47-11484号公報に開示されているように、粒子 状の触媒を貯留する深めの第1ホッパーと、前記第1ホ ッパーから流下する触媒を受け入れて流下させる浅めの 第2ホッパーと、前記第2ホッパーから流下する触媒を 縦姿勢の反応管に導入する導管とで構成した触媒供給部 を、多数の反応管に対応可能に支持フレームに位置変更 自在に支持させ、第1ホッパー内の触媒を振動させる振 動機構を設けて構成した触媒充填機が提案されている。

【0010】つまり、第1ホッパー内の触媒を振動機構 で振動させることにより、第1ホッパー内でのブリッジ の発生を防止するとともに、第1ホッパー内の触媒を第 2 ホッパーを介して反応管側に円滑に流して、触媒の流 下量にむらがないようにし、反応管内でのブリッジの発 生を防止するというのである (類似の技術として特公昭 47-13043号公報,特公昭52-4274号公報 に開示されている技術がある)。

【0011】しかしながら上記の構造によれば、触媒を 振動させていたために、触媒同士がこすれ合いを繰り返 し、粉化したり破壊されたりしやすかった。

【0012】そして前記粉化等で粉塵が発生し、この粉 塵が反応管内で凝集・はがれ・再飛散を繰り返し、反応 管ごとに反応流体の流通抵抗が異なるようになって、ブ リッジが発生したときと同様な問題が生じていた。

【0013】本発明は上記実情に鑑みてなされたもの で、その目的は、反応管への触媒の供給作業時間の短縮 化と作業者の労力の軽減化とを図るとともに、収率・選 択率を向上させ、反応管に対する温度調整の容易化を図 り、各触媒を寿命に達するまで使い切れるようにして触 媒に要するコストを低廉化する点にある。

#### [0014]

【課題を解決するための手段】請求項1による発明の構 成・作用・効果は次の通りである。

【0015】 [構成] 反応管にその上方側から粒子状の 触媒を供給する触媒供給部を、多数の反応管に各別に対 応可能に、前記反応管が並ぶ方向に位置変更自在に支持 フレームに支持させ、前記触媒供給部を構成するに、ホ ッパーから流下する触媒を載せて前記反応管に搬送供給 するコンベアを設け、前記コンベアの送り幅を、搬送幅 方向に並ぶ所定数の反応管に対応した幅に設定するとと もに、コンベア搬送面の上方の搬送空間を各反応管ごと に対応させて前記搬送幅方向で仕切る仕切り壁と、搬送 触媒の層厚さを設定する層厚さ設定部とを設け、前記コ に、作業者が触媒を各反応管に少しづつ慎重に投入して 50 ンベアが設定搬送速度で触媒を搬送するよう構成してあ

る。

【0016】[作用]

[イ]請求項1の構成によれば、ホッパーから触媒が流下してコンベアに載り、コンベアの駆動に伴って、搬送触媒が仕切り壁の作用で各反応管に対応した送り幅に設定されるとともに、層厚さ設定部により所定の層厚さに設定され、その状態で反応管に供給される。

【0017】[ロ]例えば、ホッパーからの触媒をスクリュウコンベアで反応管まで搬送すると、反応管への供給速度を一定にできるものの、触媒同士が繰り返しこす 10れ合って、破壊しやすいという不具合がある。

【0018】また従来の技術のように、ホッパー内の触媒を振動機構で振動させることにより、ホッパー内でのブリッジの発生を防止して、反応管内での触媒の流下量にむらがないようにするという技術でも、前記振動で触媒同士が繰り返しこすれ合って、破壊しやすいという不具合がある。

【0019】これに対して請求項1の構成では、触媒はホッパーから流下してコンベアに載り、その状態で反応管に搬送供給されるから、触媒同士のこすれ合いを少な 20くすることができて上記の不具合を回避でき、触媒の粉化や破壊による粉塵の発生を防止できる。

【0020】これにより、前記粉塵が反応管内で凝集・はがれ・再飛散を繰り返すことに起因する不具合、すなわち、反応管ごとに反応流体の流通抵抗が異なるようになるという不具合を回避できる。

【0021】[ハ] 所定数の反応管への触媒の供給が終わると、触媒供給部を位置変更させて、別の所定数の反応管に上記[イ]と同様にして触媒を供給し、この繰り返しで多数の反応管に各別に触媒を供給する。

【0022】[二] ところで従来は、反応管に一度に多数の触媒を投入すると、粒子状の触媒が落下中にせり合って反応管内にブリッジが生じやすいと考えられていたが、本発明者は、反応管の断面積内に納まる大きさの触媒で、かつ、単位時間当たりの投入量が所定量以下であれば、一度に多数の触媒を投入してもブリッジが発生しないことを見いだした。

【0023】[ホ] その結果、上記[イ]のように、搬送触媒を仕切り壁の作用で各反応管に対応した送り幅に設定するとともに、層厚さ設定部により所定の層厚さに設定し、コンベアの搬送速度を適切な速度に設定することで、一度に多数の触媒をコンベアで反応管に供給しても、反応管内でのブリッジの発生を回避できるようになった。

【0024】[へ]例えばコンベアの搬送速度を一定にすると、反応管への供給量にむらがなくなって、よりブリッジが生じにくくなる。そして、全ての反応管に対して同一の搬送速度(この場合も一定の搬送速度)で供給すると、全ての反応管内の触媒の分布状態が同一になりやすい。

【0025】[ト]前記[ロ],[ヘ]により、反応流体の流通抵抗が全ての反応管で同一又はほぼ同一になりやすく、その結果、

1) 反応管ごとに反応状態が異なるのを防止でき、2) 各反応管を流れる反応流体の圧力損失を均一にすることができ、3) 各反応管を流れる反応流体の量が異なるのを防止できて、各反応管内の触媒の寿命をほぼ同一にすることができるようになった。

【0026】[効果]従って、前記作用[イ]~[ハ]のように、コンベアにより各反応管に触媒を供給できて、各反応管への触媒の供給作業時間の短縮化と作業者の労力の軽減化とを図ることができ、前記作用[ロ],[二]~[ト]により、収率・選択率を上げることができ、反応管に対する温度調整の容易化を図ることができ、各触媒を寿命に達するまで使うことができて触媒に要するコストを低廉化することができた。

【0027】請求項2による発明の構成・作用・効果は次の通りである。

【0028】 [構成] 請求項1による発明の構成において、前記ホッパーの下端側の触媒流下通路を、下端部側ほど前記コンベアの搬送方向下手側に位置する傾斜通路に形成してある。

【0029】[作用]請求項1の構成による作用と同様の作用を奏することができるのに加え、ホッパーからの触媒がコンベアに、その搬送方向上手側から下手側に向かって供給されるから、コンベアへの触媒の受け渡しを円滑に行うことができて、コンベア上で触媒の量が不均一になるのを抑制できる。その結果、反応管への供給量にむらが出るのを防止できて、反応管内にブリッジがより生じにくくなる。

【0030】[効果]従って、請求項1の構成による効果と同様の効果を奏することができるのに加え、収率・選択率の向上と、反応管に対する温度調整の容易化と、触媒に要するコストの低廉化という効果を、より得やすくなった。

【0031】請求項3による発明の構成・作用・効果は次の通りである。

【0032】 [構成] 請求項1又は2による発明の構成において、前記ホッパーの触媒吐出口の垂直方向上方側に触媒の傾斜案内壁を設けて、触媒を前記傾斜案内壁で案内して前記触媒吐出口側に流下させるよう構成してある。

【0033】[作用]請求項1又は2の構成による作用と同様の作用を奏することができるのに加え、次の作用を奏することができる。

【0034】例えば、ホッパーの上部側の触媒貯留空間と触媒吐出口とが垂直に連通している構造のものでは、ホッパーの触媒吐出口が臨むコンベア搬送面部分に、ホッパー内の触媒の重量が垂直に加わる。

50 【0035】そのために、例えばコンベアをベルトコン

ベアで構成した場合、反応管への触媒の供給前は前記コ ンベア搬送面部分の負担が大きくてそのコンベア搬送面 部分が沈み込み、触媒の供給が進むと負担が小さくなっ て前記沈み込み量が小さくなるというように、触媒の供 給に伴って搬送触媒の層厚さが変わり、反応管への供給 量にむらが生じるという不具合がある。

【0036】これに対して請求項3の構成によれば、例 えば図1に示すように、下端部側ほどコンベア3の搬送 方向上手側に位置する傾斜姿勢の傾斜案内壁12を、ホ ッパー1の触媒吐出口10の垂直方向上方側に設けて、 触媒を傾斜案内壁12で案内して触媒吐出口10側に流 下させるよう構成することができる。

【0037】この構造では、ホッパー内の触媒の重量が 傾斜案内壁12に加わるから、前記コンベア搬送面部分 の負担を軽くできて、その沈み込みを抑制でき、前記不 具合 (反応管への供給量にむらが生じるという不具合) を回避できる。

【0038】[効果]従って、請求項1又は2の効果と 同様の効果をさらに得やすくなった。

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面 に基づいて説明する。

【0040】[第1実施形態] 図1,図2,図3に、多 管式触媒反応器に触媒を充填する触媒充填機を示してあ る。前記多管式触媒反応器は、例えば酸化エチレン、無 水フタル酸、無水マレイン酸、アクロレイン、アクリル 酸、メタクロレイン、メタクリル酸、アニリン、塩化ビ ニルモノマーアクリロニトリル、ピリジン、およびその 他アルカン類の脱水素等の製造に工業的な規模で使われ ている。前記触媒充填機はこの多管式触媒反応器の各反 応管2に対する触媒の充填のために用いるものである。

【0041】前記触媒充填機は、反応管2にその上方側 から粒子状の触媒を供給する触媒供給部4を、多数の反 応管2に各別に対応可能に、支持フレーム5に位置変更 機構(図示せず)を介して前記反応管2が並ぶ方向に位 置変更自在に支持させて構成してある。

【0042】前記触媒供給部4を構成するに、粒子状の 触媒を貯留するホッパー1と、ホッパー1から流下する 触媒を載せて反応管2にその上方側から搬送供給するべ ルトコンベア3とを設け、前記ベルトコンベアの送り幅 40 を、搬送幅方向に並ぶ5本の反応管に対応した幅に設定 し、ベルトコンベア3のコンベア搬送面の上方の搬送空 間を各反応管2ごとに対応させて搬送幅方向で仕切る仕 切り壁6と、搬送触媒の層厚さTを設定する層厚さ設定 板7(層厚さ設定部に相当)と、ベルトコンベア3の搬 送終端部からの触媒を各反応管2に案内するシュート8 とを設けてある。

【0043】そして、触媒供給部4から5本の反応管2 に触媒を供給し、この供給が終わると位置変更機構の作 動により触媒供給部4を位置変更させて、別の5本の反 50 大きさの触媒で、かつ、単位時間当たりの投入量が所定

応管2に触媒を供給し、この繰り返しで多数の反応管2 に各別に触媒を供給するようになっている。

【0044】前記ホッパー1内は各反納管2ごとに触媒 貯留空間14を設けてある。またホッパー1にスライド ダンパー13を設けて、作業者によるスライドダンパー 13の横方向の押し引き操作で触媒流下通路9に対する 触媒の流下を許す状態と、流下が阻止される状態とに切 り換え自在に構成してある。このスライドダンパー13 は次のように操作する。

10 【0045】1) スライドダンパー13を閉じにした状 態で、作業者がホッパー1の各触媒貯留空間14に1本 の反応管分の触媒を補給し、2) ベルトコンベア3を駆 動し(この駆動は前記1)の前に開始してもよい。) スライドダンパー13を開き操作して反応管2に触媒 を供給する。

【0046】前記ホッパー1の下端側の触媒流下通路9 を、下端部側ほどベルトコンベア3の搬送方向下手側に 位置する傾斜通路に形成するとともに、下端部側ほどべ ルトコンベア3の搬送方向上手側に位置する傾斜姿勢の 20 触媒案内壁(傾斜案内壁に相当) 12を、ホッパー1の 触媒吐出口10の垂直方向上方側に設けて、前記垂直方 向上方側の触媒を傾斜案内壁12で案内して触媒吐出口 10側に流下させるよう構成してある。

【0047】この構造により、前記ホッパー1内の触媒 の重量が触媒案内壁12と、触媒流下通路9を形成する 傾斜壁23とに加わるから、触媒吐出口10が臨むコン ベア搬送面部分の負担を軽くできて、コンベア搬送面部 分の沈み込みを抑制できる。

【0048】前記層厚さ設定板7は、ベルトコンベア3 の搬送方向下手側のホッパー側壁11に、各反応管2ご とに対応させて、上下位置変更調節自在に設けて、前記 層厚さTを反応管2に合った寸法に調節可能に構成して

【0049】ホッパー1から流下してベルトコンベア3 に載った触媒は、ベルトコンベア3の搬送に伴って、そ の上端側を層厚さ設定板7の下端部に受け止められて、 層厚さTを設定される。

【0050】搬送触媒の層厚さTは反応管2の内径より やや小さめに設定し、各反応管2に対応する一対の仕切 り壁6の間隔も同様に反応管2の内径よりやや小さめに 設定する。そして、前記ベルトコンベア3の搬送速度は 一定に設定する。

【0051】以上の構造により、ホッパー1から触媒が 流下してベルトコンベア3に載り、ベルトコンベア3の 駆動に伴って、搬送触媒が仕切り壁6の作用で各反応管 2に対応した送り幅に設定されるとともに、層厚さ設定 板7により所定の層厚さTに設定され、その状態で反応 管2に供給される。

【0052】本発明者は、反応管2の断面積内に納まる

量以下であれば、一度に多数の触媒を投入してもブリッジが発生しないことを見いだした。

【0053】その結果、上記のように、搬送触媒を仕切り壁6の作用で各反応管2に対応した送り幅に設定するとともに、層厚さ設定板7により所定の層厚さTに設定し、ベルトコンベア3の搬送速度を適切な速度に設定することで、一度に多数の触媒をベルトコンベア3で反応管2に供給しても、反応管2内でのブリッジの発生を回避できるようになった。

【0054】上記のように、ベルトコンベア3の搬送速 10 度を一定にすると、反応管2への供給量にむらがなくなって、よりブリッジが生じにくくなる。そして、全ての反応管2に対して同一の搬送速度(この場合も一定の搬送速度)で供給すると、全ての反応管2内の触媒の分布状態が同一になりやすく、反応流体の流通抵抗が全ての反応管2で同一又はほぼ同一になりやすい。

【0055】[第2実施形態]図4に第2実施形態における触媒充填機を示してある。この触媒充填機の触媒供給部4は、第1実施形態における触媒供給部4とほぼ同様の構造であり、その説明は省略する。

【0056】触媒充填機の支持フレーム5を構成するに、平面視で円形状の反応管群Aの中心部に第1フレーム部材15を設けるとともに、平面視で反応管群Aを囲む第2フレーム部材16を設け、中間フレーム部材17の一端部を第1フレーム部材15に第1縦軸芯O周りに回転自在に支持させ、中間フレーム部材17の第1縦軸芯O周りの回転に伴って、第2フレーム部材16上のガイドレール19を移動するガイド部18を、中間フレーム部材17の他端部に設けてある。

【0057】前記触媒供給部4を中間フレーム部材17に、その長手方向に沿ってスライド往復移動自在に支持させるとともに、触媒供給部4を第2縦軸芯P周りに回転自在に構成してある。

【0058】そして、中間フレーム部材17を第1縦軸芯0周りに回転させる第1駆動部と、触媒供給部4をスライド往復移動させる第2駆動部と、触媒供給部4を第2縦軸芯P周りに回転させる第3駆動部とを設けるとともに、前記第1,第2、第3駆動部(いずれも図示せず)を制御する制御装置(図示せず)を設けてある。

【0059】上記の構造により、制御装置が第1,第 2、第3駆動部を制御して次のように作動する。

【0060】触媒供給部4のベルトコンベア3の終端部(詳しくは5本のシュート8)が、5本の反応管2に臨んで触媒を供給する。次に、触媒供給部4が中間フレーム部材17上を移動して、ベルトコンベア3の終端部が別の5本の反応管2に臨み、その反応管2に触媒を供給する。

臨ませる。

【0062】中間フレーム部材17の長手方向に沿う方向に並ぶ反応管2への触媒の供給が終わると、第1フレーム部材15が第1縦軸芯0周りに回転して、上記と同様の作動で触媒を供給していく。そして、以上の作動を繰り返して、全ての反応管2への触媒の供給を完了する。ホッパー1へは触媒を適宜補給する。

【0063】[第3実施形態] 図5に第3実施形態における触媒充填機を示してある。この触媒充填機には一対の触媒供給部4を設けてある。各触媒供給部4は第1実施形態における触媒供給部4とほぼ同様の構造であり、説明は省略する。

【0064】触媒充填機の支持フレーム5を構成するに、平面視で円形状の反応管群Aの半円部分を覆う状態に跨がる四角枠状の第1枠体20と、この第1枠体20上をその長辺に沿う方向にスライド移動する四角枠状の第2枠体21と、第2枠体21上を前記第1枠体20の短辺に沿う方向にスライド移動する四角枠状の第3枠体22とを設けてある。

20 【0065】そして前記第3枠体22に前記一対の触媒 供給部4を、互いのベルトコンベア3の終端部が対向す る状態に載置固定し、第2,第3枠体21,22をスラ イド移動させる第1駆動部と、その第1駆動部を制御す る制御装置(共に図示せず)とを設けてある。

【0066】上記の構造により、制御装置が第1駆動部を制御して次のように作動する。

【0067】各触媒供給部4のベルトコンベア3の終端部(詳しくは5本のシュート8)が、5本の反応管2に臨んで触媒を供給する。次に、第3枠体22がスライド移動して、各触媒供給部4のベルトコンベア3の終端部が別の5本の反応管2に臨み、その反応管2に触媒を供給する。

【0068】第1枠体20の短辺に沿う方向に並ぶ反応管2への触媒の供給が終わると、第2枠体21スライド移動して、別の反応管2に上記と同様の作動で触媒を供給していく。そして、以上の作動を繰り返して、反応管群Aの半分の反応管2への触媒の供給を終える。

【0069】次に、第1枠体20を反応管群Aの別の半円部分を覆う状態に跨がらせ、上記と同様の作動でその40 半円部分の反応管2に触媒を供給する。

【0070】[第4実施形態]図6に第4実施形態における触媒充填機を示してある。この触媒充填機は第3実施形態における充填機を小型にしたもので、前記四角枠状の第1枠体20が平面視で円形状の反応管群Aの一部分(反応管群Aの半円部分よりも小さい)に跨がるようになっている。

【0071】この充填機は第3実施形態における充填機に比べると運搬が容易であるという利点がある。なお前記反応管群Aに対して複数台設置して、触媒を充填させることもできる

【0072】 [別実施形態] 前記ベルトコンベア3の送 り幅を、搬送幅方向に並ぶ6本以上あるいは4本以下の 反応管2に対応する幅に設定してあってもよい。

【0073】ホッパー1へは、ニューマチックコンベア (空気を媒体とするコンベア) により触媒を供給するよ う構成してもよく、あるいは人為的に供給するよう構成 してあってもよい。

【0074】前記反応管2が触媒で満杯になったことを 例えば光センサーで検出し、その検出情報に基づいて、 う構成してもよい。

【0075】つまり、ホッパー1に多量の触媒を貯留し ておいて、反応管2が触媒で満杯になったことを光セン サーが検出すると、その検出情報に基づいて、制御装置 の制御によりベルトコンベア3を停止させる。この場 合、各反応管2ごとにベルトコンベア3を設けて、各ベ ルトコンベア3を独立して駆動させる。 なおスライドダ ンパー13は開放状態にしておく。

【0076】そして、別の反応管2側に触媒供給部4を 位置変更させ、再びベルトコンベア3を駆動させて触媒 20 を供給する。触媒供給部4が前記反応管2側に位置した ことは位置センサーで検出する。

【0077】前記ホッパー1の下端側からホッパー1内 に圧縮空気を間欠的に噴出するノズルを設けて、ホッパ -1内の触媒の詰まりを防止するよう構成してあっても よい。例えば、ベルトコンベア3の搬送方向下手側のホ ッパー側壁11の下端側に前記ノズルを設けて、ホッパ -1の触媒吐出口10から触媒流下通路9内に、後ろ斜 め上方に向けて $1 \text{ Kg/cm}^i$  のエアーパルスを1 se $c/2\sim3$  s e c 間隔で噴出するよう構成する。

### [0078]

【実施例1】本発明の方式による高速充填が可能である 事を証明する為に以下の実験を行なった。直径5mm、 高さ6mmの円柱形の触媒粒子を用い、内径25mm、 高さ2mの反応管に投入を行なった。投入は1100g /分であった。

【0079】一方、比較のために同じ触媒粒子を用いて 同じ管に手作業による充填を行なった。この充填はでき るだけ一個ずつ触媒が投入されるように、約300g/ 分で実施した。

【0080】この時の圧力損失の平均は277.8mm H, O、標準偏差は3.9mmH,Oであった。

【0081】一方本触媒充填機を用いて充填を行なった 反応管の平均圧力損失は267.7mmH, 0、標準偏 差は3mmH,0であり、3倍の高速充填を行なったに もかかわらず、一個づつ投入する従来の作業より小さな ばらつきであることがわかった。

#### [0082]

【実施例2】 [触媒の粉化と触媒層圧力損失のばらつ き] 触媒の粉化、発塵による触媒層圧力損失への影響を 50 1

調査するために以下のような実験を行なった。

【0083】比較的発塵しやすい直径5mm、高さ6m mの円柱形の触媒粒子を用い、粉塵の発生しやすい振動 フィーダーで内径25mm、高さ2mの反応管に投入し た。150g/分の速度で反応管が満杯になるまで充填 を行なったところ、平均圧力損失が320mmH。Oと 大きく、また標準偏差も24.78mmH, Oという大 きなばらつきをもった。

【0084】この管に対して下部から強制エアブローを 前記制御装置で第1、第2,第3駆動部等を制御するよ 10 実施して発生粉塵を除去したところ、平均圧力損失が3 01mmH, Oに低下するとともに、その標準偏差も 6.7mmH, Oにまで低下した。よって圧力損失のば らつき発生に粉塵の発生が大きく寄与していることが明 らかになった。

> 【0085】同様の条件で本発明にかかる触媒充填機を 用いると、圧力損失の平均307mmH。O、その標準 偏差は3.7mmH, Oと小さくなり、振動フィーダー に対する優位性が示された。

#### [0086]

【実施例3】触媒充填機の有用性を示すために、実際に 多管式触媒反応器に充填した場合のばらつきと、充填速 度を手作業で行った場合と比較した。実験は以下のよう な多管式触媒反応器において触媒の充填を行なった。管 内径24.5mm、長さ4mである。触媒は直径5m m、高さ6mmの円筒形セラミック担持触媒を用いた。 比較データーは手作業による充填作業から得た。手作業 は漏斗と樹脂製ビーカーを用い、管にできるだけ1個づ つ触媒を投入していく方法によった。

【0087】手作業充填の速度は4分30秒/1本、こ 30 れに対して触媒充填機は1分/1本で充填を実施した。 【0088】また、手作業・触媒充填機のどちらによる 場合も、1本に充填する量を予め秤量し、同量が充填で

【0089】圧力損失のばらつきは以下のようになっ た。

【0090】手作業による充填平均圧力損失 9 mmH, O/4 m、標準偏差12.2 mmH, O/ 4 m触媒充填機使用平均圧力損失 331 mm H, 0/ 4 m、標準偏差 7. 6 mm H, O / 4 m このように、従 40 来の手作業と比較して高速かつばらつきの少ない充填を 実現する事ができた。

#### 【図面の簡単な説明】

きるようにした。

【図1】触媒充填機の触媒供給部を示す概略側面図

【図2】触媒供給部の斜視図

【図3】触媒供給部の平面図

【図4】第2実施形態の斜視図

【図5】第3実施形態の斜視図

【図6】第4実施形態の斜視図

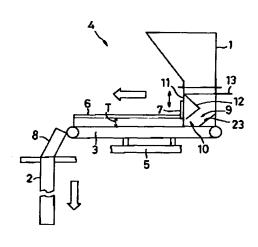
【符号の説明】

ホッパー

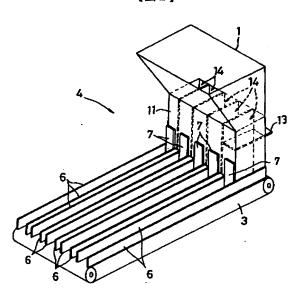
11

| _ |        |     |   |
|---|--------|-----|---|
| 2 | 反応管    | 7   | 層厚さ設定部                                  |
| 3 | コンベア   | 9   | 触媒流下通路                                  |
| 4 | 触媒供給部  | 1 0 | 触媒吐出口                                   |
| 5 | 支持フレーム | 1 2 | 傾斜案内壁                                   |
| 6 | 仕切り壁   |     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |

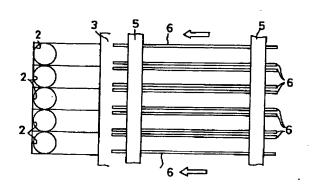
【図1】



[図2]



【図3】



【図4】

